



设备简介

GL8 CLIV Gen2是天仁微纳新型全幅高精度紫外纳米压印设备，标配天仁微纳CLIV (Contact Litho in Vacuum) 压印技术，可实现200mm基底面积上高精度（优于10nm*）、高深宽比（优于10比1*）纳米结构复制量产。

该设备支持自动复制柔性复合工作模具，工作模具具有精度高，寿命长等特点，可以显著降低大面积纳米压印工艺中模具使用成本。CLIV技术的应用保证了大面积纳米压印过程中结构精度与高深宽比结构的完整填充，同时保证了大面积结构压印均匀性。

GL8 CLIV Gen2纳米压印设备适用于DOE、AR/VR衍射光波导（包括斜齿光栅）、线光栅偏振、超透镜、生物芯片、LED、微透镜阵列等应用领域的研发和量产。

GL8 CLIV Gen2

200mm 高精度紫外纳米压印光刻设备

设备参数

兼容基底尺寸	2inch、100mm、150mm、200mm
	特殊尺寸可定制
支持基底材料	硅片、玻璃、石英、塑料、金属等
上下片方式	手动上下片
晶圆预对位	机械夹持预对位，可选装光学巡边预对位
纳米压印技术	CLIV技术，适合高精度、高深宽比纳米结构压印
压印精度	优于10纳米*
结构深宽比	优于10比1*
残余层控制	可小于10nm*
紫外固化光源	紫外LED（365nm）面光源，光强>1000mW/cm ² ，水冷冷却（2000mW/cm ² 类型光源可选配）
设备内部环境	标配，外部环境Class100
控制	内部环境优于Class 10*
自动压印	支持
自动脱模	支持
自动工作模具	支持
复制	
模具基底对位	自动对位（选配）
功能	

*参数取决于模具、材料、工艺和使用环境，非设备极限

*天仁微纳保留对信息的解释权

主要功能

- 经过量产验证的200mm大面积、高精度、高深宽比纳米压印
- CLIV技术，确保压印结构精度与结构填充完整性
- 设备内自动复制柔性复合工作模具，降低大面积纳米压印模具使用成本
- 自动对位、自动压印、自动曝光固化、自动脱模，工艺过程无需人工干预
- 标配高功率紫外LED面光源（365nm，光强>1000mW/cm²），水冷冷却，特殊功率以及特殊、混合波长光源可订制，完美支持各种商用纳米压印材料
- 标配设备内部洁净环境与除静电装置
- 随机提供全套纳米压印工艺与材料，包括DOE、AR斜齿光栅、高密度、高深宽比结构以及微透镜阵列等工艺流程，帮助客户零门槛达到国际领先的纳米压印水平

OUR CONTACT!

GermanLitho GmbH
 Götttschlag 6b
 85391 Allershausen Germany
 Tel: +49 (0) 8166 6999069
 Fax: +49 (0) 8166 9987619
 E-mail: contact@germanlitho.com

联系方式
 青岛天仁微纳科技有限责任公司
 青岛市城阳区祥阳路106号-青岛未来科技产业园6号楼
 电话: 0532-67769322
 传真: 0532-67768286
 电子邮件: contact@germanlitho.com
 网址: www.germanlitho.com